

**即时发布**

## **半导体行业领军人物 Bala Thumma（巴拉图玛）加入 D2S 担任副总裁**

*Bala Thumma 将负责 D2S 的 GPU 加速像素剂量校正 (PLDC) 技术，该技术可提高所有光罩，特别是曲线形状光罩的图形保真度和精度。*

圣荷西, 加州, 美国, 二零二四年九月十日——

D2S 是一家为半导体制造提供 GPU 加速解决方案的供应商，今天宣布，半导体行业领军人物、前 Synopsys 高管 Bala Thumma 加入公司，担任像素级剂量校正 (PLDC) 副总裁。Bala 在软件、半导体制造和电子设计自动化 (EDA) 领域拥有超过 25 年的经验，将推动 D2S 的 PLDC 解决方案的发展和客户关系。

光罩制造中的 PLDC 技术应用于多光束光罩刻写机，通过操控单个像素的剂量而非调整几何形状来增强图形保真度和精度。这种校正方法改善了边缘对比度和轮廓，解决了诸如线端缩短和 CD 误差等问题，而无需将数据转换回基于边缘的轮廓几何形状。PLDC 在 GPU 上运行，运算超快，使其能够高效地校正包括传统曼哈顿图形在内的任何图形，而在处理曲线形状图形时也不会增加运行时间。

D2S 首席执行官藤村先生 (Aki Fujimura) 表示：“我很高兴在光罩领域和 Bala 合作多年。他和我有着相似的背景，最初都来自 EDA 布线软件领域，后来转向半导体制造软件。理解我们客户的客户的技术和需求，有助于我们更好地服务于我们的制造客户。我期待他为增强我们提供创新解决方案的能力，和加速整个半导体行业对光罩制造的认可做出贡献。”

Bala Thumma 表示：“我很高兴加入 D2S，并成为在一个在半导体制造最先进节点工具开发领域处于创新前沿的团队的一员。PLDC 技术代表了光罩制造的重大进步，利用 GPU 加速来提高图形保真度和精度。我和 Aki Fujimura 相识多年，他是半导体制造领域的行业领军人物，我期待与 Aki 和 D2S 的优秀团队合作，推动这项技术的发展，确保我们的客户以更高的精度和效率满足先进半导体设计的日益增长的需求。”

Bala 在半导体光罩社区中很知名，他在 BACUS 指导委员会任职超过十年，还曾在曲线格式指导小组任职。在加入 D2S 之前，Bala 在 Synopsys 工作了 20 年，在此期间他担任了多个重要职位，包括芯片工程组的高级总监，负责 Synopsys 的计算机辅助转录系统 (CATS) 软件产品的开发，该产

品是光罩数据处理领域的市场领导者。在他职业生涯的早期，Bala 曾在英特尔 (Intel) 工作，领导了一个内部布线工具的设计、开发和成功部署。在此之前，他曾在 VLSI Technologies 的子公司 Compass Design Automation 从事布线工作。

Bala 获得了印度瓦朗加尔 (Warangal) 国家理工学院的电子与通讯工程学士学位、南伊利诺伊 (Illinois) 大学爱德华兹维尔 (Edwardsville) 分校的计算机科学硕士学位，以及亚利桑那州立大学 W. P. Carey 商学院的 MBA 学位。他还拥有多项关于集成电路设计中基于时序的工程变更命令的专利。

D2S, Inc. 公司简介:

D2S 是为半导体制造业提供用 GPU 加速技术解决方案的供应商。本公司为尖端半导体仪器合作伙伴提供可定制的模拟技术。D2S 的 TrueMask® 技术，应用其 GPU 计算设计平台 CDP，使得利用曲线形状的先进光罩设计成为可能，并能在所需限定时间内刻写完毕，以确保最好的晶圆质量和成本节省。D2S 是 the eBeam Initiative (电子束倡议团体) 的主办者和电子制造深度学习中心 (CDLe) 的创建成员。公司成立于 2007，总部设于加州圣荷西。要获得更多信息，请查阅:

[www.design2silicon.com](http://www.design2silicon.com).

D2S, the D2S logo 和 TrueMask 是 D2S 公司的注册商标。

经办代理:

David Moreno (大卫 穆锐农)

Principal

Open Sky Communications

电话: +1.415.519.3915

电邮: [dmoreno@openskypr.com](mailto:dmoreno@openskypr.com)

###